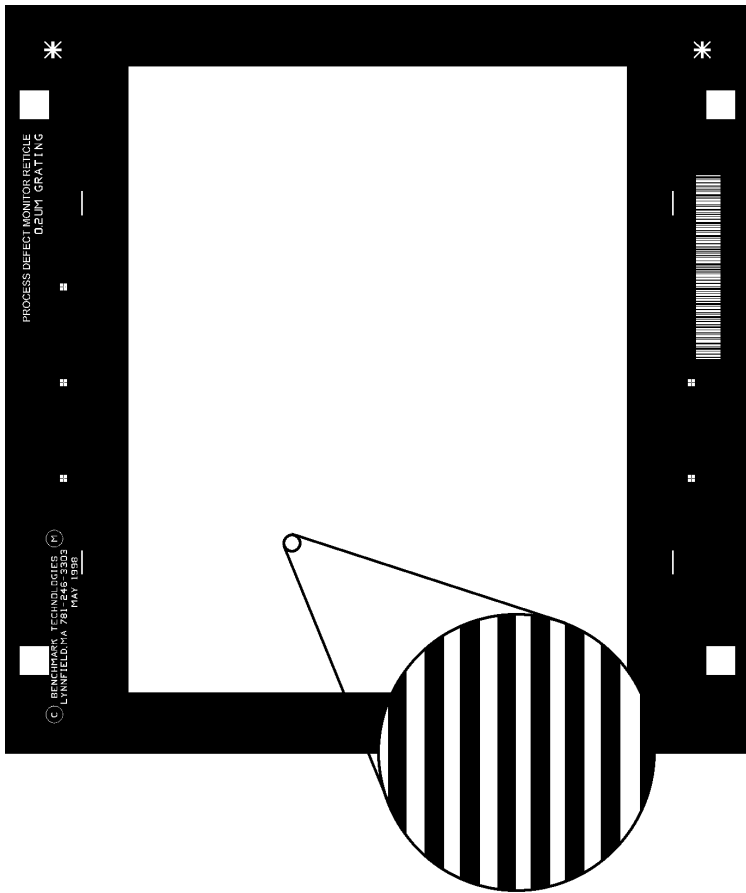


Process Defect Monitor Reticles



Benchmark Technologies 社の Process Defect Monitor レティクルは、今日の $0.25\ \mu\text{m}$ からサブミクロンのデザイン・ルールに関わるクリティカルなプロセスの欠陥を識別するため特別に設計されています。

Process Defect Monitor レティクルは、レジスト、露光、現像の過程で発生する製造時の欠陥を迅速かつ正確に発見します。これらの欠陥は、微粒子汚染、レジストのマイクロバブル、現像残留を含んでいます。

自動測長検査装置で利用できるよう設計された Process Defect Monitor レティクルは、特性解析の時間を大幅に短縮し、クリティカルな半導体製造工程における生産性を改善します。

特長

- 自動ウェーハ欠陥検査装置に対応した設計
- 欠点の迅速な発見に対応した設計
- レティクルは、 $0.5\ \mu\text{m}$ 以内の欠陥無し設計
- ペリクルで保護されたレティクル
- 最小ピッチでのライン

用途

- 塗布、露光、現像の過程で発生する欠陥の検査
- 微粒子汚染の監視
- レジスト塗布時のマイクロバブル、現像残留の発見
- プロセス影響変動の監視
- 欠陥の感度の決定

Benchmark

TECHNOLOGIES
7 Kimball Lane, Bldg. E
Lynnfield MA 01940 USA
Phone (781) 246-3303
Fax (781) 246-0308
Web www.benchmarktech.com